This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

MAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP401009216A

PAT-NO: JP401009216A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01009216 A

TITLE: EPOXY RESIN

PUBN-DATE: January 12, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MURAI, TAKAAKI SAKAI, KATSUHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME DAICEL CHEM IND LTD COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP62203919

APPL-DATE: August 17, 1987

INT-CL (IPC): C08G059/34; C07D303/04; C07D303/14

US-CL-CURRENT: 525/387

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an epoxy resin which is excellent in heat resistance,

weather resistance and water resistance, by submitting 4-vinylbicyclo[2,2,1]hept-1-ene oxide to a ring opening polymn. in the presence

of an org. active hydrogen as an initiator and then epoxidizing the product.

CONSTITUTION: 4-Vinylbicyclo[2,2,1]hept-1-ene oxide is submitted to a ring

opening polymn. in the presence of an org. active hydrogen compd. (e.g.,

trimethylolpropane) as an initiator to give an unsatd. compd. of formula I

(where R<SB>1</SB> is an org. compd. residue having l active hydrogen atoms;

n<SB>1</SB>∼n<SB>1</SB> are each 0.1∼100, and their sum is 1∼100; 1

is 1∼100; A is of formula 11). This unsatd. compd. is then reacted with

an epoxidizing agent (e.g., peracetic acid) to give an epoxy resin formula IV

(where B is of the formula V; X is of the formula III, -CH=CH<SB>2</SB>, etc.)

contg. at least one group of formula III. This resin is favorably used as a

resin for sealing semiconductors.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成6年(1994)4月19日

【公開番号】特開平1-9216

【公開日】平成1年(1989)1月12日

【年通号数】公開特許公報1-93

【出願番号】特願昭62-203919

【国際特許分類第5版】

C08G 59/34 NHU 8416-4J

CO7D 303/04 8314-4C

> 8314-4C 303/14

平成5年6月29日

特許庁長官 麻生 遊 殿

昭和 52年特許 顧 第 2 0 3 9 1 9 号



2. 発明の名称

エポキシ樹脂

3、 補正をする者

事件との関係 特許出願人

大阪府堺市鉄砲町1番地

(290) ダイセル化学工業株式会社

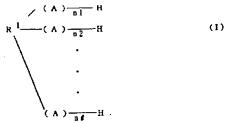
代表者 晃島章郎

明細書の特許調求の範囲の概および発明の群

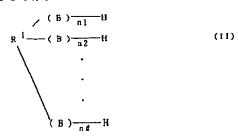
細な説明の機

- 5. 網正の内容
- (1) 特許請求の範囲を抵付別紙の通りに補正する。
- (2) 明細書の第8頁3行目~第10頁下から3行目 の文章を削除して以下の文章に置き換える。

「一股式(I)



で衷される不飽和化合物を、エポキシ化剤と反応 させて得られる一般式(II)



[ただし、一般式(I) において、Aは次式で表わ

される

一般式(II)において、 B は次式で扱わされる



<R²は日、アルキル基、カーボアルキル基、カ

- ボアリール基のいずれか一つであるが、

に含まれる>

<一般式(I)および一般式(II)において、R¹ は ♪ 借の活性水業を有する有機化合物残基、nl、

 $\lceil \cdot \cdot \cdot \cdot \rceil \mid R_2 \mid \cdot \mid \cdot \mid \downarrow \neq \square - \rfloor$

Г••• (R¹ : トリメチロー J に格正する。

(7) 明細書の第26頁最下行

「を確認した、」

の次に以下の応用例-1を追加する。

「応用例-1

実施例で得られたエポキシ化合物100部、フ ェノール機脂(群栄化学性PSP 4300、フェニル当 盘110)を39.7部、トリフェニルフォスフィンを 0.7部を溶融混練して取りだし、エポキシ樹脂粗 成物を得た。これを冷却被粉砕し、90℃、100kg/ cm²でプレス成形し、170℃で5時間硬化させて硬 化物を作成した。この硬化物のガラス転移温度を 測定したところ、205℃であった。また、吸水率 は0.18%(20℃、24時間没漬後)であった。」 (以下余白)

n2、 · · · ns はそれぞれ 0 又は 1 ~ 1 0 0 の 整数で、その和が1~100、1は1~100 の整数を表す>]

で表されるエポキシ樹脂」

(3) 明細巻の第11頁2行目

FR,J

(4) 明細書の第14頁下から7行目

「一般式(II)」

「一般式(I)および(II)」

(5) 明煕書の第14頁下から7行目

の前に

「それぞれ」

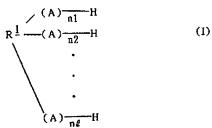
を追加する。

(6) 明福書の第26頁15行目

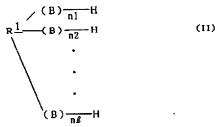
別紙

2. 特許請求の範囲

一般式(I)



で表される不飽和化合物を、エポキシ化剤と反応さ せて得られる一般式(II)



 $\underline{[ただ}$ し、 $\underline{- 般式(I)}$ において、A は次式で表わさ れる

一般式(II)において、Bは次式で表わされる

<u>--</u> ただし、X は

$$-CH - CH_2$$
, $-CH = CH_2$

- C H - C H 2 O H O R 2

 $\leq R^2$ は日、アルキル基、 $\underline{n} - \underline{x}$ アルキル基、 $\underline{n} - \underline{x}$ アリール基のいずれか一つであるが、

- CH - CH₂ O <u>が</u>少なくとも1個<u>一般式(II)</u>の樹脂中に 今まれるこ

<<u>一般式(I)および一般式(II)において、</u>R¹ は & 個の活性水素を有する有機化合物残基、n1、n2、・・・n8 は <u>それぞれ 0 又は 1</u> ~ 1 0 0 の整数

で、その和が1~100<u>,</u> l は1~100の整数 を表す>]

で表されるエポキシ樹脂。